Name: .		MatrNr.:	
Name: .	••••••		

## Klausur: Grundlagen der Elektronik WS 16/17

## Kurzfragen ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 30 min)

- 1) Die Steilheit eines MOSFETs kann erhöht werden, wenn man (richtige ankreuzen)
- 2) Welche der Aussagen zu einem Halbleiter im thermodynamischen Gleichgewicht sind richtig?
- 3) Um welche digitale Grundschaltung handelt es sich bei dem Bild rechts unten? Um welche Transistoren handelt es sich bei  $M_1$  und  $M_2$  (Funktionsprinzip, Details)?
- 4) Betrachten Sie die nebenstehende Schaltung mit einem idealen Operationsverstärker. Bestimmen Sie die Ausgangsspannung  $u_a$  in Abhängigkeit von den Eingangsspannungen  $u_1$  und  $u_2$  sowie den Widerständen.
  - Wie lässt sich die Funktion der Schaltung beschreiben?
- 5) Welche der Aussagen zur Kapazität C einer pn-Diode mit abruptem Übergang, homogenen Dotierungen und Vorspannung  $U_0$  zwischen p- und n-Bereich sind zutreffend?
- 7) Gegeben ist das Bändermodell W(x) von Si. Markieren Sie für den Fall der n-Dotierung das Ferminiveau  $W_F$ . Skizzieren Sie die Zustandsdichten der Elektronen im Leitungsband und der Löcher im Valenzband D(W) in parabolischer Näherung, sowie bei Raumtemperatur die Fermi-Verteilung f(W) und die Elektronen- und Löcherkonzentrationen im Leitungs- bzw. Valenzband n(W), p(W) in den vorbereiteten Koordinatensystemen.
- 8) Welche der Aussagen zu dem gezeigten Bändermodell mit den Bandkanten  $W_{\rm V}$  und  $W_{\rm L}$  sind richtig? Markieren Sie an den Pfeilen das Quasi-Ferminiveau  $W_{\rm Fn}$  für die Elektronen bzw.  $W_{\rm Fn}$  für die Löcher.
- 9) Wir betrachten die Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerkonzentration  $n(T_0/T)$  von n-leitendem Silizium mit  $W_G = 1,11$  eV,  $W_L W_D = 0,06$  eV,  $N_D = 10^{15}$  cm<sup>-3</sup>. Skizzieren Sie diese einfach logarithmisch in die gegebene Vorlage. Ergänzen Sie die Achsenbeschriftung  $(T_0 = 300 \text{ K})$ . Markieren Sie die drei charakteristischen Bereiche Eigenleitung (1), Störstellenreserve (2) und Störstellenerschöpfung (3). Ordnen Sie anhand der Ziffern (1), (2) bzw. (3) die jeweilige Temperaturabhängigkeit zu.
- 10) Ergänzen Sie die folgenden Aussagen zu den Eigenschaften zweier bis auf ihre effektive Elektronenmasse im Leitungsband ( $m^*_{L,A} < m^*_{L,B}$ ) identischer Halbleiter A und B in den punktierten Bereichen durch ">", "<" oder "=".

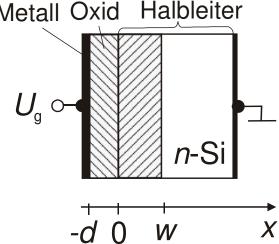
Name:....

## Klausur: Grundlagen der Elektronik WS 16/17

Aufgaben ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 2 Std.)

**Konstanten**:  $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}; k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} = 8,6 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}; m_0 = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}; c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}; h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}; h = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Ws}^2; \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As/(Vm)}; \mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/(Am)}; N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ Atome/mol}$ 

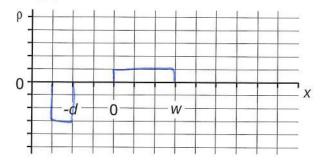
1) Abb. 1 zeigt eine ideale Metall-Oxid-n-Halbleiter (MOS)-Struktur mit am metallartigen Poly-Silizium-Gate anliegender Spannung  $U_g$ . Gehen Sie, wie bei 300 K üblich, davon aus, dass die Dotierstoffe vollständig ionisiert sind  $(N_D^+ = N_D^-) = 10^{16}$  cm<sup>-3</sup>) und die beweglichen Ladungsträger in der Sperrschicht  $(0 \le x \le w)$  keine Rolle spielen. Für den Kapazitätsbelag der Oxidschicht  $C_{ox} = \varepsilon_{ox}\varepsilon_0/d$  und der Sperrschicht  $C_S = \varepsilon_S\varepsilon_0/w$  mit den relativen Dielektrizitätskonstanten  $\varepsilon_S$  und  $\varepsilon_{ox}$  sowie den Dicken d und w sind folgende Daten Abb. 1 gegeben: d = 20 nm;  $\varepsilon_{ox} = 3$ ;  $\varepsilon_S = 11,7$ ;  $n_i = 10^{10}$  cm<sup>-3</sup>.



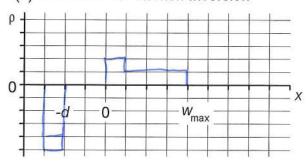
- a) Skizzieren Sie das vereinfachte Kapazitäts-Ersatzschaltbild der MOS-Struktur. Ermitteln Sie den Gesamtkapazitätsbelag der Struktur C bezogen auf  $C_{\rm ox}$  in Abhängigkeit von der Sperrschichtausdehnung w. Skizzieren Sie für niedrige (gestrichelt) und hohe (durchgezogen) Frequenzen den Verlauf von  $C/C_{\rm ox}$  in Abhängigkeit von  $U_{\rm g}$ . Markieren Sie die Bereiche der Anreicherung, Verarmung und Inversion sowie den Flachbandfall  $(C/C_{\rm ox})_{\rm FB}$ .
- b) Skizzieren Sie in der Vorlage die Verläufe der Raumladung, der elektrischen Feldstärke und der Bandkanten  $W_L$  und  $W_V$  für den Fall des Einsetzens der schwachen Inversion (1) mit  $W_s = W_F W_i$  und der starken Inversion (2) mit  $W_s = 2(W_F W_i)$ . Markieren Sie  $W_s$ ,  $W_i$ ,  $W_L$  und  $W_V$  sowie die Fermienergien im Metall  $W_{F,M}$  und im Halbleiter  $W_{F,S}$ .
- c) Bestimmen Sie die Bandaufwölbung  $W_s$  im Halbleiter in Abhängigkeit von der entsprechenden Dotierungskonzentration N, für die  $N_D$  bzw.  $N_A$  einzusetzen ist, und der Eigenleitungskonzentration  $n_i$  (Formel) mit:

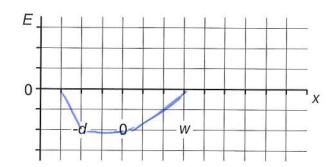
$$n = N_{\rm L} \exp\left(\frac{W_{\rm F} - W_{\rm L}}{kT}\right)$$
;  $n_{\rm i} = N_{\rm L} \exp\left(\frac{W_{\rm i} - W_{\rm L}}{kT}\right)$ 

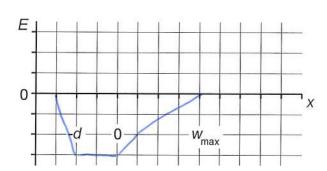
(1) Einsetzen der schwachen Inversion

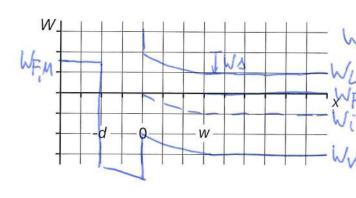


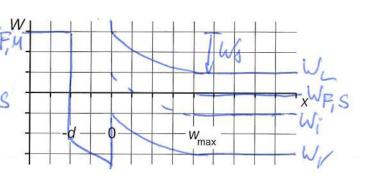
(2) Einsetzen der starken Inversion











d) Bestimmen Sie die bei (2) erreichte maximale Ausdehnung der Sperrschicht  $w_{\text{max}}$  mit:

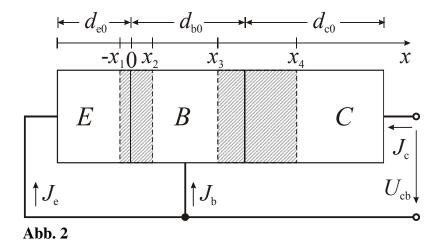
$$w_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \varepsilon_{\text{S}} \varepsilon_{\text{0}} W_{\text{s}}}{q^2 N_{\text{D}}}}$$

und daraus die minimale relative Kapazität  $(C/C_{\rm ox})_{\rm min}$  (Formeln und Zahlenwerte für beide Größen). Folgende Daten sind gegeben:  $N_{\rm D}=10^{16}~{\rm cm}^{-3};~d=20~{\rm nm};~\varepsilon_{\rm ox}=3;~\varepsilon_{\rm S}=11,7;~n_{\rm i}=10^{10}~{\rm cm}^{-3}.$ 

Name:
1 Name

2) Der Bipolar-Transistor in <u>Abb. 2</u> mit den unten gegebenen Daten soll bei T = 300 K analysiert werden. Thermische Generation/Rekombination von Ladungsträgern in den Verarmungszonen (schraffiert) und Spannungsabfälle über den Bahngebieten sind zu vernachlässigen. Die Kontakte sind ideal ohmsch. Weiter gilt:  $n_i = 10^{10}$  cm<sup>-3</sup>,  $\varepsilon_S = 11,7$ ,  $U_{cb} = -6,7$  V sowie:

	Emitter	Basis	Kollektor
Dotierungskonzentration	$N_{\text{Ae}} = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ >> $N_{\text{De}}$	$N_{\rm Db} = 10^{16}  \rm cm^{-3}$ >> $N_{\rm Ab}$	$N_{\rm Ac} = 10^{14}  \rm cm^{-3}$ >> $N_{\rm Dc}$
Ausdehnung Bahngebiete	$d_{\rm e0} = 10 \; \mu \rm m$	$d_{b0} = 3 \ \mu m$	$d_{c0} = 20 \ \mu m$
Diffusionslänge	$L_{\rm ne} = 20 \ \mu \rm m$	$L_{\rm pb} = 50 \ \mu {\rm m}$	$L_{\rm ne} = 100 \ \mu \rm m$
Beweglichkeit	$\mu_{\rm ne} = 180 \text{ cm}^2/\text{Vs}$	$\mu_{\rm pb} = 500 \; {\rm cm^2/Vs}$	$\mu_{\rm nc} = 1000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$



Hinweis: An den *pn*-Übergängen (mit dem Spannungspfeil von *p* nach *n*) gilt allgemein:

$$w = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm S}\varepsilon_{\rm 0}(U_{\rm D} - U)}{\rm q}\left(\frac{1}{N_{\rm A}} + \frac{1}{N_{\rm D}}\right)} = w_{\rm n} + w_{\rm p}; \quad N_{\rm A}w_{\rm p} = N_{\rm D}w_{\rm n}$$

$$U_{\rm D} = \frac{kT}{\rm q}\ln\left(\frac{N_{\rm A}}{p_{\rm n0}}\right); \quad p_{\rm n0}N_{\rm D} = n_{\rm i}^2; \quad p_{\rm n}(x_{\rm n}) = p_{\rm n0}\exp\left(\frac{\rm q}{kT}\right) . N$$

Ersetzen Sie im Folgenden die hier benutzten allgemeinen Parameter  $w_{n,p}$  (Ausdehnung der Verarmungszone im n-Bahngebiet/p-Bahngebiet) und  $x_n$  (Rand des n-Bahngebietes zur Verarmungszone) durch die zum Transistor gehörigen Parameter auf der x-Achse in Abb. 2.

- a) Berechnen Sie kT/q, die Diffusionsspannungen  $U_{Deb}$  und  $U_{Deb}$  sowie die Ausdehnung der neutralen Basis  $d_b = x_3 x_2$  (Formeln) und zahlenmäßig.
- b) Ermitteln Sie die Minoritätsladungsträgerkonzentration  $y_b(x)$  an den Rändern der neutralen Basis  $x_2$  und  $x_3$  und skizzieren Sie deren Verlauf in der neutralen Basis. Markieren Sie die Gleichgewichtskonzentration  $y_{b0}$ . Geben Sie zuvor den Typ der Minoritätsladungsträger an, der in der Basis vorliegt, d.h. ersetzen Sie hier und im Folgenden y durch n oder p.
- c) Für die Stromgleichung der Elektronen bzw. Löcher in einem Halbleiter gilt allgemein:

$$J_{\rm n} = \sigma_{\rm n} E + kT \mu_{\rm n} \frac{dn}{dx}$$
 bzw.  $J_{\rm p} = \sigma_{\rm p} E - kT \mu_{\rm p} \frac{dp}{dx}$ 

mit der elektrischen Leitfähigkeit  $\sigma_{n,p}$  und Feldstärke E. Für die Kontinuitätsgleichung gilt:

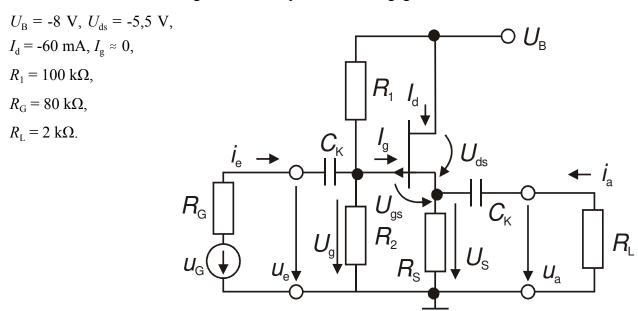
$$\frac{1}{kT\mu_{n}}\frac{dn}{dt} = \frac{1}{kT\mu_{n}}\frac{dJ_{n}}{dx} - \frac{n-n_{0}}{L_{n}^{2}} \text{ bzw.} \quad \frac{1}{kT\mu_{p}}\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{kT\mu_{p}}\frac{dJ_{p}}{dx} - \frac{p-p_{0}}{L_{p}^{2}}$$

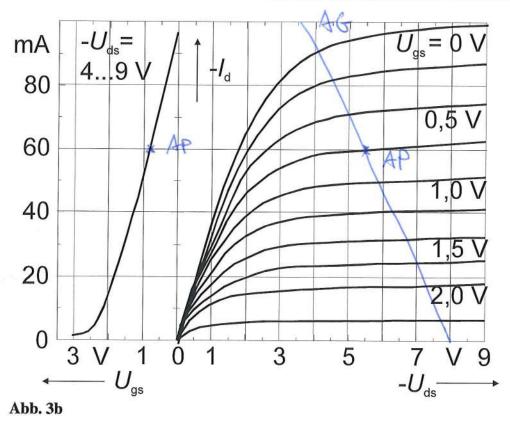
Stellen Sie hieraus eine Differentialgleichung (DGL) für  $y_b(x)$  im stationären Zustand auf.

d) Lösen Sie die DGL mit den Randbedingungen aus b) in Abhängigkeit von  $U_{\rm cb}$  und dem Ansatz

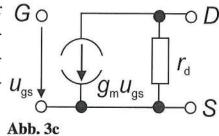
$$y_b = A \cdot \sinh\left(\frac{x_3 - x}{L_{yb}}\right) + B \cdot \sinh\left(\frac{x - x_2}{L_{yb}}\right) + y_{b0}$$
.

- e) Berechnen Sie die Minoritätsladungsträger-Stromdichte an den Rändern der neutralen Basis  $J_y(x_2)$  und  $J_y(x_3)$  (Formeln und Werte) und den Basistransportfaktor  $\beta_T = J_y(x_3)/J_y(x_2)$  (Formel und Wert).
- 3) Analysieren Sie die Schaltung in <u>Abb. 3a</u>. Der Transistor ist durch das Kennlinienfeld in <u>Abb. 3 b</u> charakterisiert. Folgende Betriebsparameter sind gegeben:



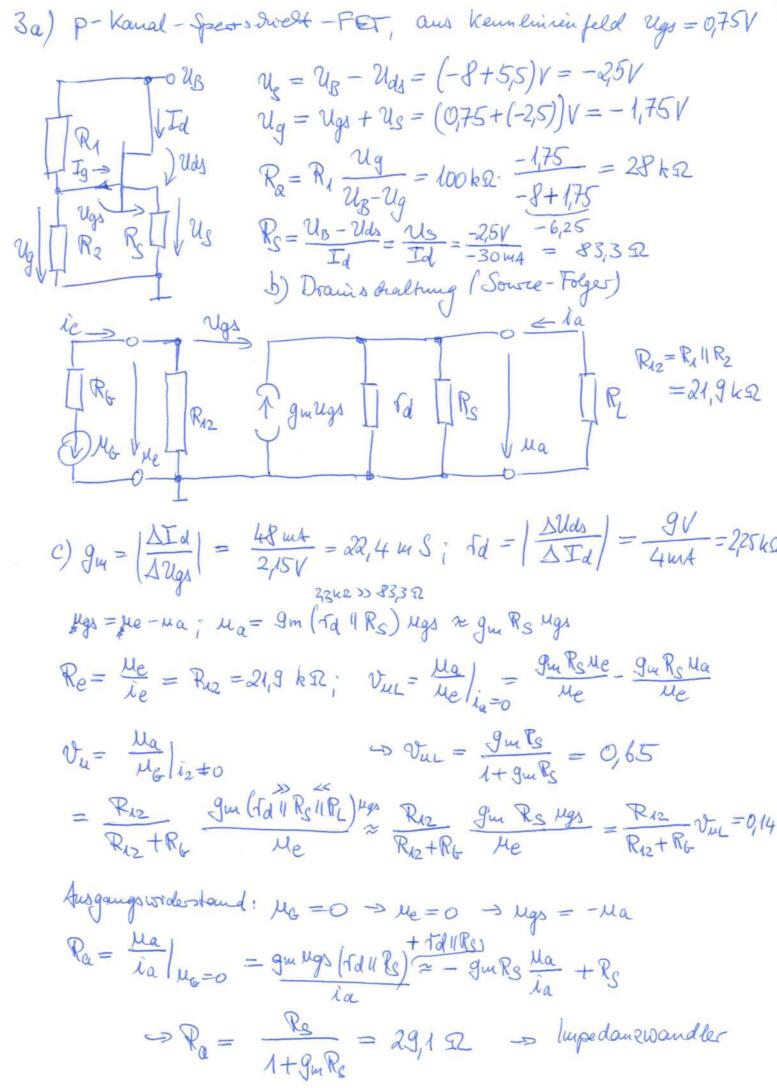


- a) Welcher Transistortyp liegt vor? Zeichnen Sie das Gleichstromersatzschaltbild. Tragen Sie die Arbeitspunkte (AP) und die Arbeitsgerade (AG) in das Kennlinienfeld (Abb. 3b) ein. Lesen Sie  $U_{\rm gs}$  im AP ab und ermitteln Sie  $U_{\rm S}$ ,  $U_{\rm g}$  und die Widerstände  $R_{\rm 2}$  und  $R_{\rm S}$ .
- b) Führen Sie eine Wechselstromanalyse durch. Welcher G C Schaltungstyp liegt vor? Zeichnen Sie hierzu die Ersatzschaltung unter Verwendung des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes für den Transistor (Abb. 3c). Die Konden- U<sub>gs</sub> satoren stellen hierbei Kurzschlüsse dar.



c) Ermitteln Sie aus dem Kennlinienfeld (Abb. 3b) im AP die Ersatzschaltbild-Parameter  $g_{\rm m} = |\Delta I_{\rm d}/\Delta U_{\rm gs}|_{\rm AP}$  und  $r_{\rm d} = |\Delta U_{\rm ds}/\Delta I_{\rm d}|_{\rm AP}$ . Bestimmen Sie aus b) mit Hilfe der in a) ermittelten Werte den Eingangswiderstand  $R_{\rm e} = u_{\rm e}/i_{\rm e}$ , die Leerlaufspannungsverstärkung  $v_{\rm uL} = u_{\rm a}/u_{\rm e}$  ( $i_{\rm a} = 0$ ), die Spannungsverstärkung  $v_{\rm u} = u_{\rm a}/u_{\rm G}$  ( $i_{\rm a} \neq 0$ ) und den Ausgangswiderstand  $R_{\rm a} = u_{\rm a}/i_{\rm a}$  ( $u_{\rm G} = 0$ ) der Schaltung formel- und zahlenmäßig. Benennen Sie ein Anwendungsbeispiel.

$$\begin{array}{lll} & \lambda_{a} & \lambda_{bb} & = & \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{N_{Ae}}{P_{bo}} \right) = & \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{N_{Ae}}{N_{12}} \right) = 0, \, \text{RS} \, V \\ & V_{DCb} & = & \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{N_{AC}}{N_{DD}} \right) = & \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{N_{AC}}{N_{DD}} \right) = 0, \, \text{SG} \, V \\ & W_{e} & = & \frac{N_{AC}}{N_{Ae} + N_{Db}} \left( \frac{2\xi_{4}\xi_{6} \left( V_{Dcb} + V_{Dcb} \right)}{q} \right) & \frac{2\xi_{4}\xi_{6} \left( V_{Dcb} + V_{Dcb} \right)}{q} & \frac{2\xi_{4}\xi_{6} \left( V_{Dcb} - V_{Cb} \right)}{q} & \frac{2\xi_{4}\xi_{6} \left( V_{Dcb} - V_{C$$



Heruntergeladen durch sdcefv wewy (xef49338@eoopy.com)